

## EV GROUP UNLOCKS AGILE AND EFFICIENT PRODUCTION SCALING WITH NEXT-GENERATION STEP-AND-REPEAT NANOIMPRINT LITHOGRAPHY SYSTEM – June 9, 2021

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today announced the EVG@770 NT—its next-generation step-and-repeat nanoimprint lithography (NIL) system. The EVG770 NT enables precise replication of micro- and nano-patterns for large-area master stamp fabrication used in high-volume manufacturing of augmented reality (AR) waveguides, wafer-level optics (WLO) and advanced lab-on-a-chip devices.

东方网首页 手机版 客户端 东方网输入法
登录 注册

新闻 | 滚动 | 上海 | 政务 | 区镇 | 舆情 | 评论 | 国内 | 社会 | 政法 | 国际 | 军事 | 财经 | 体育 | 娱乐 | 历史 | 汽车 | 图片 | 视频 | 曝光 | 微博 | 专题 | 彩票 | 健康 | 百货



政务服务一点通  
Government Cooperate Service Develop



gov.eastday.com



东方军情观察  
海陆空装备盛宴



东方体育无限


东方网 | 企业 东方网 >> 企业频道 >> 商业资讯 >> 正文
我要投稿 热线电话: 60950360

### EV集团 (EVG) 通过下一代分步重复光刻纳米压印系统实现敏捷高效的规模生产

2021-6-9 11:25:53 来源: 东方网 编辑: 谢天舒

EVG 770 NT支持用于增强现实(AR)波导、晶圆级光学器件和先进生物医学芯片的复杂微纳结构的大面积母版排版技术

2021年6月9日,奥地利圣弗洛里安—微机电系统(MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团(EVG)今天推出下一代分步重复光刻纳米压印(NIL)系统EVG 770 NT。EVG770 NT能够精确复制用于增强现实(AR)波导、晶圆级光学器件(WLO)和先进晶片实验室设备等批量生产应用中的大面积母版排版的微纳图形。到目前为止,由于大面积精确母版供应有限,分步重复NIL的进一步发展和生产规模仍然受到制约。EV集团(EVG)利用NIL和分步重复制造领域的数十年经验,将EVG770 NT设计为完全的生产导向型系统,以最大限度地提升性能、生产率和过程可控性。EVG770 NT具备业内领先的测量精度和分辨率,最大能够扩展至300毫米晶圆和第二代面板尺寸。利用这种先进系统,客户能够更好地实现批量生产高成本效益、高保真NIL图案的承诺。



EVG 770 NT分步重复光刻纳米压印系统

#### 要闻滚动

- 增强金融消费者获得感——兴业银行信用卡...
- 打造苏州张家港、工业园区城市智能体,华...
- 吴江区携手华为共建“华为(吴江)工业互...
- 朝中绿色生活上市火爆进行中,引发社会广...
- 科大讯飞2020年净利润增长近七成 多赛道优势...
- 顺应时代发展,布局探索新型营销之路
- “家生活”赋能 国美线上线下一体化布局已...
- 前程无忧测评荣获“2021中国招聘与任用供...

#### 图片新闻



Type only通过驱动天下



广汽康定定制版钉钉拍



世界地球日·恒天财富



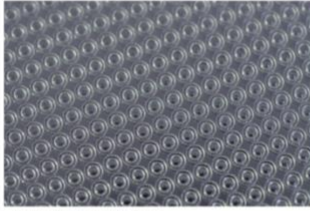
“微信视频号”创建首河南

#### 投资理财

- 对话恒天基金首席策略分析师张霞: 谈增量...
- 市场震荡不知何时上车, 度小满陪你基金定...
- 鸿坤财富亮相: 从十四五规划和2035年远景...
- 第五届中国财经RFP理财精英评选4月17日开

### 分步重复EUV的优势

晶圆级光学元件 (WLO) 是推动EUV芯片的主要市场之一。从改进手机数码相机自动对焦功能，到用于提升智能手机安全性的面部识别，再到用于增强现实和虚拟现实 (VR) 耳机的3D建模与成像技术改进，WLO为移动消费电子产品开辟了多种全新应用。分步重复EUV采用以电子束或其他技术写入的单片晶圆母模，在基板上进行多次复制，制造出大面积母模和模版。从实现WLO生产以及用于微波器件中使用的小型结构制造成本效益。由此产生的分步重复母模，可用于生产后纳晶圆级和晶圆级制造的工作模版。



用于晶圆级光学器件的300毫米分步重复母模

EUV能够在更大的基板上复制更大的母模，因此能够同时生产更多器件，扩展单个大型器件的生产规模，且无需排班、金角石粘附、激光直写和电子束直写等传统母模制作工艺产率低、安装成本高昂。因此非常适合于大型基模，与这些技术相比，EUV具有明显的产量和成本优势。采用分步重复工艺，既能使用最佳性能的晶片，还能够有效地将过蚀现象引入生产链。

EUV集团 (EUV) 技术总监 Thomas Glanville 博士表示：“EUV十年磨一剑，不断开发和完善分步重复母模母模技术，旨在使更广泛的市场和应用都得益于EUV的制造优势。在EUV的不断努力下，EUV70 开始运营，实现了自由曲面光学器件或高真纳米图形与高经济效益大规模生产的无缝连接。利用突破性的分步重复解决方案，客户能够自由创建自己的母模，在产品完成整个EUV工艺流程，从而提供灵活性，加快生产周期速度。对于希望探索将EUV用于新产品或小生产需求的客户，EUV在XIL Photonics 能力中心内提供分步重复母模服务，该中心是我们面向客户和合作伙伴的开放式创新中心，可编结新光子器件和应用程序的上市时间。”

#### 性能与规模的突破

EUV70 拥有多种有助于工艺开发和生产效率提升的特性，包括：

将最大90毫米 x 80毫米的晶圆头，晶片倾斜无死角复制到最大300毫米晶圆基板和第二代面板 (770x470毫米) 上

250纳米以下标度精度和500纳米以下分辨率

支持工作模版批量生产，避免高昂昂的母模模版

采用高功率新型曝光光源设计，显著缩短曝光时间

为包括显微和实时过程摄像机提供输入信息，对工艺结果进行移动验证和监视

非接触式空气轴承，最大程度减少颗粒污染

配备自动基板倾斜和模版更换单元，以及可容纳五部模版的存储缓冲区

压力和机械力原位控制和表征

软件可以升级为EUV最新计算机集成制造 (CIM) 框架平台，能够在EUV大批量生产流程设备上使用

#### 产品上市信息

EUV70 现已交付给部分客户，目前EUV正在接收新订单。EUV在位于总部的XIL Photonics 能力中心提供设备演示和分步重复母模母模服务。

#### EUV参加SPIE 数字光学技术会议

EUV将在6月21-23日在该举行的SPIE 数字光学技术会议上发表发表一篇特邀论文，介绍EUV在制造高折射率波导方面的优势。

#### 关于 EV 集团 (EUV)

EUV集团 (EUV) 是为半导体、微机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的全球供应商。其主要产品包括：晶圆级母模、晶圆级母模、光刻/光刻的半印刷 (NIL) 与测量设备，以及光刻胶涂布机、滴液机和检测系统。EUV集团成立于1980年，能够为全球各地的客户和合作伙伴提供最佳服务与支持。

#### 【广告】

(免责声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，不代表作者个人观点，与本站无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。)

<http://qiye.eastday.com/n34/u1ai875014.html>